

УДК 541.128+541.14+546.261:620.193

СИНТЕЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ Fe/TaON/β-Si₃N₄/β-Si₃Al₃O₃N₅ ДЛЯ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ ХЛОРАМФЕНИКОЛА В ВОДЕ

© 2023 г. Л. Н. Скворцова¹, *, К. И. Казанцева¹, К. А. Болгару²,
А. А. Регер², И. А. Артюх¹, К. А. Дычко¹

¹Национальный исследовательский Томский государственный университет, пр. Ленина, 36, Томск, 634050 Россия

²Томский научный центр СО Российской академии наук, пр. Академический, 10/3, Томск, 634021 Россия

*e-mail: lnskvorcova@inbox.ru

Поступила в редакцию 05.08.2022 г.

После доработки 28.12.2022 г.

Принята к публикации 11.01.2023 г.

Методом автоволнового горения в азоте ферросиликоалюминия с добавками металлического тантала (0, 5, 10, 15 мас. %) получены металлокерамические композиты Fe/TaON/β-Si₃N₄/β-Si₃Al₃O₃N₅. Установлен фазовый состав, изучены морфологические особенности и оптические свойства композитов. Проведена оценка кислотно-основных свойств поверхности, адсорбционной и фотокаталитической активности композитов в процессе деградации хлорамфеникола при облучении УФ- и видимым светом. Показана высокая эффективность композитов для окислительной деструкции хлорамфеникола (98%) при облучении видимым светом.

Ключевые слова: самораспространяющийся синтез, металлокерамические композиты, оксинитрид тантала

DOI: 10.31857/S0002337X23030120, **EDN:** YTVAKH

ВВЕДЕНИЕ

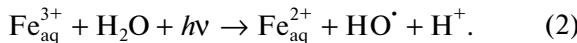
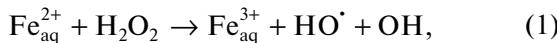
Отходы лекарственных и фармацевтических средств получили название органических микрозагрязнителей, поскольку характеризуются высокой токсичностью и вызывают рост вредного воздействия на водную систему [1]. Полное удаление фармацевтических поллютантов из водных сред связывают с применением передовых окислительных технологий (AOPs – Advanced Oxidative Processes), сущность которых состоит в генерации частиц с высокой реакционной способностью. В этой связи возник интерес к применению гетерогенного фотокатализа как передовой технологии окисления.

В гетерогенном фотокатализе перспективны полупроводниковые материалы. Для сдвига активности полупроводниковых фотокатализаторов в область видимого света используют композиционные материалы, состоящие из нескольких полупроводников, для расширения диапазона действующего света. Установлена высокая эффективность комбинированных фотокатализаторов $g\text{-C}_3\text{N}_4/\text{TiO}_2$, $\text{ZnO}_2/g\text{-C}_3\text{N}_4$, $\text{PbO}/\text{Bi}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3$ и Ag/CeO_2 в процессах очистки воды от антибиотиков, хлорорганических соединений и красителей при облучении видимым светом [2–5]. Пер-

спективным для синтеза композиционных фотокатализаторов является TaON [6, 7], который способен поглощать в видимой области спектра ($E_g = 1.8\text{--}2.06$ эВ) [8]. В работе [9] отмечена стабильность керамических материалов на основе сиалона и Si₃N₄ в качестве носителей для фотокатализаторов.

Нами установлена высокая фотокаталитическая активность железокерамических композитов на основе нитридов бора, кремния и сиалона в процессах окислительной деструкции диклофенака при УФ-облучении [10, 11]. Эффективность катализаторов обусловлена наличием в керамической матрице широкозонных полупроводников (β-Si₃N₄, β-Si₃Al₃O₃N₅) и фазы металлического железа, что в присутствии H₂O₂ дает возможность для совмещения гетерогенного и гомогенного фотокатализа. В гомогенном фотокатализе эффективным является процесс Фентона (реакция (1)). Реакцию Фентона можно ускорить облучением ультрафиолетовым светом, в результате чего ионы Fe³⁺ конвертируются в ионы Fe²⁺ с образованием дополнительного количества гидроксильных радикалов (реакция (2)). Реакции ионов Fe²⁺/Fe³⁺ с H₂O₂ в условиях УФ-излучения называют фото-

Фентон-процессом, он обладает высокой эффективностью как возобновляемый источник HO^\cdot -радикалов [12]:



Цель настоящего исследования – синтез железосодержащих металлокерамических композитов на основе нитрида кремния и сиалона, включающих полупроводниковые соединения тантала, для деструкции хлорамфеникола (CHL) в условиях облучения видимым светом.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Синтез материалов. Железосодержащие металлокерамические композиты получали в режиме автоволнового горения в азоте смеси, состоящей из ферросиликоалюминия (**ФСА**) и добавок металлического тантала: 0, 5, 10, 15 мас. %. Использовали сложный ферросплав ФСА промышленной марки ФС45А15. Проводили предварительную механоактивацию смеси в планетарной мельнице АПФ-5 с центробежной силой 60г. Азотирование активированной смеси порошков проводили в установке постоянного давления объемом 3 л с рабочим давлением 10 МПа. Реакцию горения инициировали с помощью электрического импульса, передаваемого от трансформатора.

Методы исследования. Фазовый состав материалов изучали методом рентгенофазового анализа на дифрактометре XRD6000 (Япония, Shimadzu) при Со-излучении со скоростью съемки 2–4 град/мин. Для расшифровки дифрактограмм использовали программное обеспечение Match3 с базой данных PDF 4. Морфологию поверхности исследовали на растровом электронном микроскопе (**РЭМ**) HitachiTM-3000 при ускоряющем напряжении 15 кВ в условиях режима снятия зарядки с образца (электронная пушка: 5 × 10–2 Па; камера для образца: 30–50 Па). Микрорентгеноспектральный анализ (**МРСА**) поверхности проводили с использованием приставки Quantax 70 к РЭМ. Оптические свойства материалов исследовали на приборе UV-Visible Spectrophotometr Evolution 600, в качестве базового эталона использовали MgO. Регистрировали спектры диффузного отражения, которые преобразовывали в электронные спектры поглощения, используя функцию Кубелка–Мунка ($F = (1 - R)^2 / 2R$, где R – коэффициент диффузного отражения). Ширину запрещенной зоны (E_g) определяли по краю основной полосы оптического поглощения, экстраполируя линейный участок зависимости $[F(R)E]^2 = f(h\nu)$ до пересечения с осью $h\nu$.

Методом pH-метрии изучали интегральную кислотность поверхности композитов по методике [13]. Распределение поверхностных центров по кислотно-основным свойствам исследовали индикаторным методом Гамметта и Танабе с использованием 15 индикаторов со значениями pK_a в интервале $-0.29\dots+12.8$. Рассчитывали концентрацию активных центров (q) [14], эквивалентную количеству адсорбированного красителя с определенным значением pK_a и строили зависимость $q_{pK_a} = f(pK_a)$. Функцию кислотности поверхности композитов рассчитывали как среднестатистическую величину по уравнению

$$H_0 = \frac{\sum pK_a q_{pK_a}}{\sum q_{pK_a}}, \quad (3)$$

где q_{pK_a} – количество центров данной кислотной силы.

Источники излучения. В качестве источника УФ-излучения использовали ртутную лампу высокого давления типа ДРЛ-250 с наиболее интенсивной линией при 254 нм. Источник видимого излучения – светодиодная лампа DIORA 30 (ЗАО “Физтех-Энерго”, г. Томск).

Методика адсорбционного и фотокатализического эксперимента. Композит (200 мг) помещали в стеклянный/кварцевый стакан емкостью 100 мл заливали 10 мл раствора CHL ($C = 25$ мг/л, pH 3). Стакан закрывали и ставили на магнитную мешалку на 10 мин. Для протекания фото-Фентон-процесса добавляли 0.1 мл 0.1 М H_2O_2 . В фотокатализическом эксперименте источник излучения располагался на расстоянии 20 см от мешалки. Контроль CHL в растворе осуществляли методом спектрофотометрии при 278 нм на приборе Evolution 600 (USA). Степень адсорбции/деградации CHL (R , %) оценивали по убыли из раствора:

$$R, \% = \frac{(C_{\text{нач}} - C_{\text{ост}})}{C_{\text{нач}}} \times 100, \quad (4)$$

где $C_{\text{нач}}$ и $C_{\text{ост}}$ – начальная и остаточная концентрации CHL в растворе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Увеличение добавки тантала к ФСА приводит к уменьшению количества поглощенного азота и скорости распространения фронта волны горения (рис. 1). Это связано с большим размером частиц металлического тантала, что приводит к уменьшению от 0.85 до 0.76 м²/г удельной поверхности исходного материала, способного реагировать с азотом.

В табл. 1 представлен фазовый состав композитов. Основными фазами материалов являются

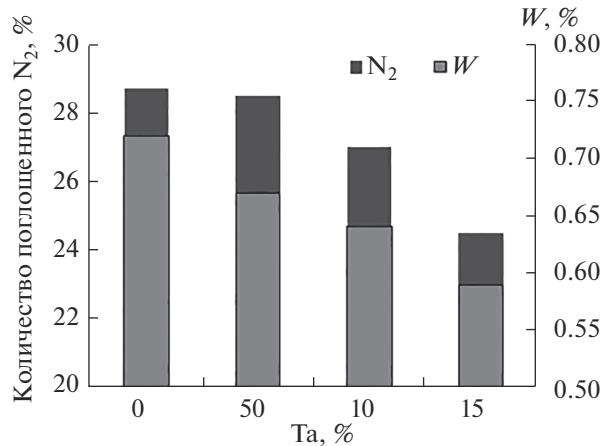


Рис. 1. Влияние добавки тантала на количество поглощенного азота и скорость горения порошковой смеси ФСА + Та.

$\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ и $\beta\text{-Si}_3\text{Al}_3\text{O}_3\text{N}_5$ с преобладанием нитрида кремния и металлический $\alpha\text{-Fe}$. В композите 1 (без Та) также присутствуют силициды железа (Fe_xSi_y) – промежуточные продукты азотирования ФСА. В композитах 2–4 обнаружены фазы оксинитрида (TaON) и пентаоксида (Ta₂O₅) тантала (рис. 2).

По результатам рентгенофазового анализа определены типы структур основных фаз композитов и параметры кристаллической решетки (табл. 2).

Микрофотографии поверхности исследуемых композитов (рис. 3) свидетельствуют об их полидисперсности, гранулы образцов представляют собой агломераты частиц с большим разбросом по размерам зерна. Введение в шихту 5% Та (образец 2) практически не влияет на структуру образца по сравнению с образцом 1. Все частицы распределены относительно равномерно по поверхности материала. Добавка тантала приводит к уменьшению температуры горения от 2150 до 1920°C (0% Та – 2150, 5% Та – 2100, 10% Та – 2000, 15% Та – 1920). Увеличение степени разбавления исходной шихты танталом до 10–15% (образцы 3, 4) приводит к образованию крупных капель расплава

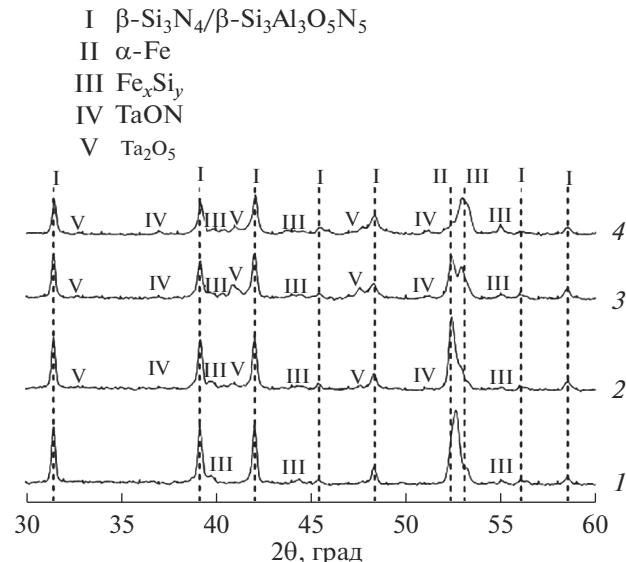


Рис. 2. Фрагменты рентгенограмм азотированных образцов ФСА с различными добавками Та: 1 – 0, 2 – 5, 3 – 10, 4 – 15 м.-%.

железа, окруженных кристаллами нитрида кремния. При таком разбавлении снижаются температура горения и, соответственно, скорость распространения послойного горения, что приводит к более длительному нахождению реагентов в зоне реакции.

Результаты локального МРСА поверхности (табл. 3) указывают на то, что темные частицы преимущественно представляют собой керамическую матрицу, содержащую нитриды и оксоконитриды кремния и алюминия. Рентгенофазовый анализ показал наличие в данных областях $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4/\beta\text{-Si}_3\text{Al}_3\text{O}_3\text{N}_5$. В светлых частичках железа значительно больше, что может свидетельствовать о наличии (свободного) металлического железа.

Исследование оптических свойств композитов проводили с использованием спектров поглощения (рис. 4). В состав керамической матрицы входят широкозонные полупроводники $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$, $\beta\text{-Si}_3\text{Al}_3\text{O}_3\text{N}_5$, поглощающие в области 230–350 нм,

Таблица 1. Фазовый состав, содержание тантала и функция кислотности поверхности композитов (H_0)

Композит	1	2	3	4
Ta _{доб} , м.-%	0	5	10	15
Фазовый состав	$\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$, $\alpha\text{-Fe}$, $\beta\text{-Si}_3\text{Al}_3\text{O}_3\text{N}_5$, Fe_xSi_y	$\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$, $\alpha\text{-Fe}$, $\beta\text{-Si}_3\text{Al}_3\text{O}_3\text{N}_5$, TaON, Ta ₂ O ₅	$\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$, $\alpha\text{-Fe}$, $\beta\text{-Si}_3\text{Al}_3\text{O}_3\text{N}_5$, TaON, Ta ₂ O ₅	$\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$, $\alpha\text{-Fe}$, $\beta\text{-Si}_3\text{Al}_3\text{O}_3\text{N}_5$, TaON, Ta ₂ O ₅
Ta, ат. %	0	0.03–0.07	0.18–5.0	0.1–4.1
H_0	5.40	5.61	6.12	5.47

Таблица 2. Типы структур и параметры кристаллических решеток фаз в образцах композитов

Фазы композита	Тип структуры	<i>a</i> , Å	<i>b</i> , Å	<i>c</i> , Å
$\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$	Гексагональная	7.6	7.6	2.91
$\beta\text{-Si}_3\text{Al}_2\text{O}_3\text{N}_5$	Гексагональная	7.6	7.6	2.98
$\alpha\text{-Fe}$	Кубическая	2.87	2.87	2.87
TaON	Моноклинная	4.971	5.034	5.18
Ta ₂ O ₅	Ромбическая	3.70	3.89	6.53

Таблица 3. Содержание (ат. %) элементов в разных локальных областях поверхности композитов по результатам МРСА

Элемент	<i>C</i> , ат. %															
	1				2				3				4			
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
Si	29	26	25	24	46	30	25	30	28	39	25	27	46	30	26	28
N	45	49	48	42	29	40	31	45	12	43	20	44	15	51	44	47
Al	12	12	14	17	14	9	14	12	21	9	13	13	11	8	18	13
O	8	10	7	5	7	11	7.9	10	4.4	7	11	10	4	9	8	9
Fe	6	3	6	12	2.9	10	22	3	34	2	25	5.5	23	1.9	3	2.8
Ta	0	0	0	0	0.1	0	0.1	0	0.6	0	6	0.5	1	0.1	1	0.2

Примечание. См. рис. 3.

и среднезонный полупроводник TaON. При сопоставлении спектров поглощения можно отметить лишь незначительные отличия: добавки металлического тантала в количестве 10, 15 мас. %

(образцы 3, 4) приводят к увеличению степени поглощения композитов в области ~330 нм. Определение E_g полупроводника TaON, поглощающего в области 540–560 нм ($E_g \approx 2$ эВ) [8], оказалось за-

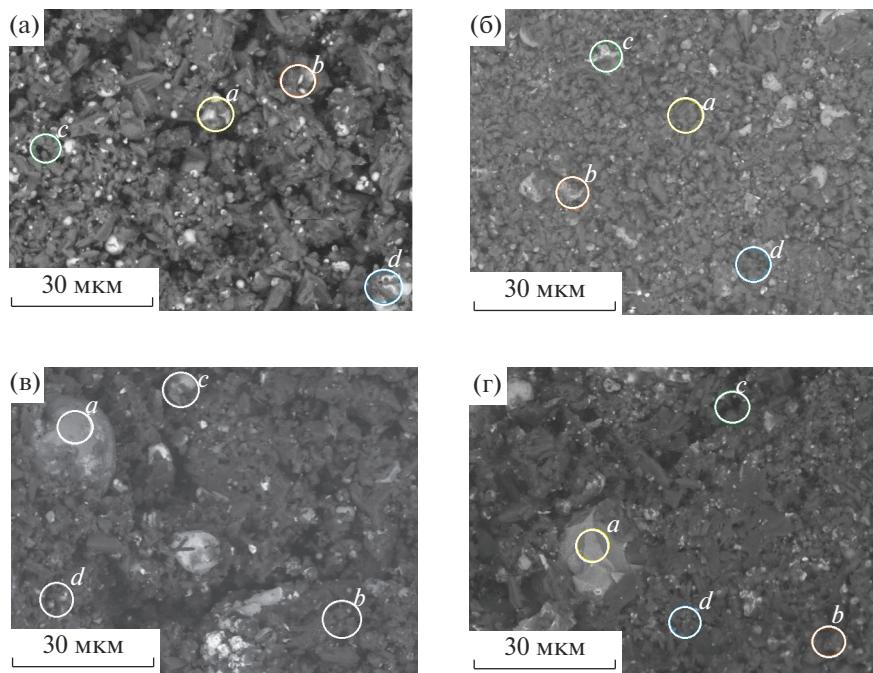


Рис. 3. Микрофотографии композитов 1 (а), 2 (б), 3 (в), 4 (г) (см. табл. 1).

труднительным из-за влияния других полупроводниковых соединений.

Нитрид кремния является основной фазой керамической матрицы композитов. Определение ширины запрещенной зоны $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ проводили из зависимостей $[F(R)E]^2 - h\nu$ (рис. 5).

Полученные значения E_g представлены в табл. 4, где они сопоставлены с литературными данными для полупроводников, входящих в состав керамической матрицы. Ширина запрещенной зоны полупроводников исследуемых композитов ниже E_g нитрида кремния [15], но согласуется с величиной E_g для $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$, установленной нами для композита на основе $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$, включающего небольшие количества сиалона [16]. С увеличением добавки tantalа в исходную шихту наблюдается уменьшение E_g нитрида кремния. Это может быть связано с влиянием полупроводника TaON с более низким значением E_g , что может приводить к разделению зарядов.

Каталитическая активность композитов зависит от кислотно-основных свойств поверхности, которые определяют реакционную способность и избирательность адсорбции. Методом pH-метрии проведена оценка интегральной кислотности поверхности (рис. 6). Плавное смещение pH кинетических кривых в слабоосновную область указывает на присутствие уже гидроксилированных бренстедовских центров.

Кривые распределения центров адсорбции (РЦА) с определенным значением pK_a красителей-индикаторов Гамметта в диапазоне $-0.29\ldots12.80$ представлены на рис. 7. На поверхности композита 1 преобладают основные центры Льюиса $\equiv\text{N}$: и слабокислотные центры Бренстеда $=\text{N}:\text{H}-\text{OH}^{\delta-}$. На поверхности образца 2 преобладают сильнокислотные центры Бренстеда ($\text{SiO}-\text{H}^{\delta+}$, $\text{AlOH}-\text{H}^{\delta+}$); образец 3 содержит большое количество слабокислотных центров Бренстеда ($pK_a = 6.4$), образованных фазой $\alpha\text{-Fe}$ ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) и основных центров Бренстеда ($pK_a = 10.5$). Образец 4 по характеру РЦА идентичен образцу 1 с преобладанием центров Бренстеда с $pK_a = 7.1$. Значения функции кислотности Гамметта композитов (табл. 1) свидетельствуют о слабокислотной природе их поверх-

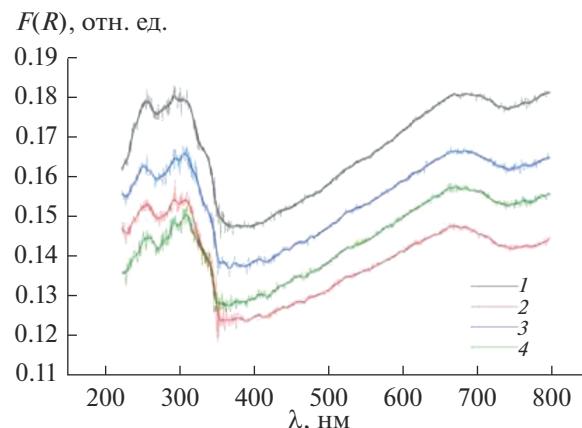
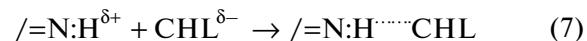
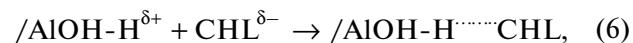
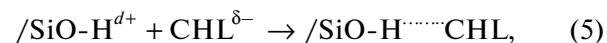


Рис. 4. Электронные спектры поглощения металлокерамических композитов.

ности и повышенной селективности к слабоосновным молекулам.

В табл. 5 приведены результаты исследования адсорбционной и фотокаталитической активности композитов с различной дисперсностью частиц в процессе окислительной деструкции CHL. Крупнодисперсная фракция включала частицы с размером $0.65\ldots2.5$ мм, мелкодисперсная <0.65 мм. Все композиты характеризуются достаточно высокой и сопоставимой адсорбционной активностью к CHL, что коррелирует с количеством активных центров с $pK_a = 5.5$ и $pK_a = 11.3$ на поверхности композитов (рис. 7). Слабокислотные свойства CHL обусловлены наличием вторичной аминогруппы ($=\text{NH}$, $pK_a = 5.5$) и фенольных групп ($-\text{OH}$, $pK_a = 11.3$), поэтому процесс адсорбции можно представить с участием кислотных и основных центров Бренстеда:



($/$ – символы поверхности композита).

Каталитическая активность образцов крупнодисперсной фракции в условиях УФ- и видимого света определяется морфологическими осо-

Таблица 4. Результаты оценки ширины запрещенной зоны полупроводников в композитах

Композит	E_g , эВ	Полупроводник	E_g , эВ
1	3.25	$\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$	4.0–4.5 [15]
2	3.22	$\text{Si}_{6-x}\text{Al}_x\text{O}_x\text{N}_{8-x}$	2.3–5.3 [17]
3	3.15	$\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$,	3.3 [16]
4	3.14	$\beta\text{-Si}_3\text{Al}_3\text{O}_3\text{N}_5$	

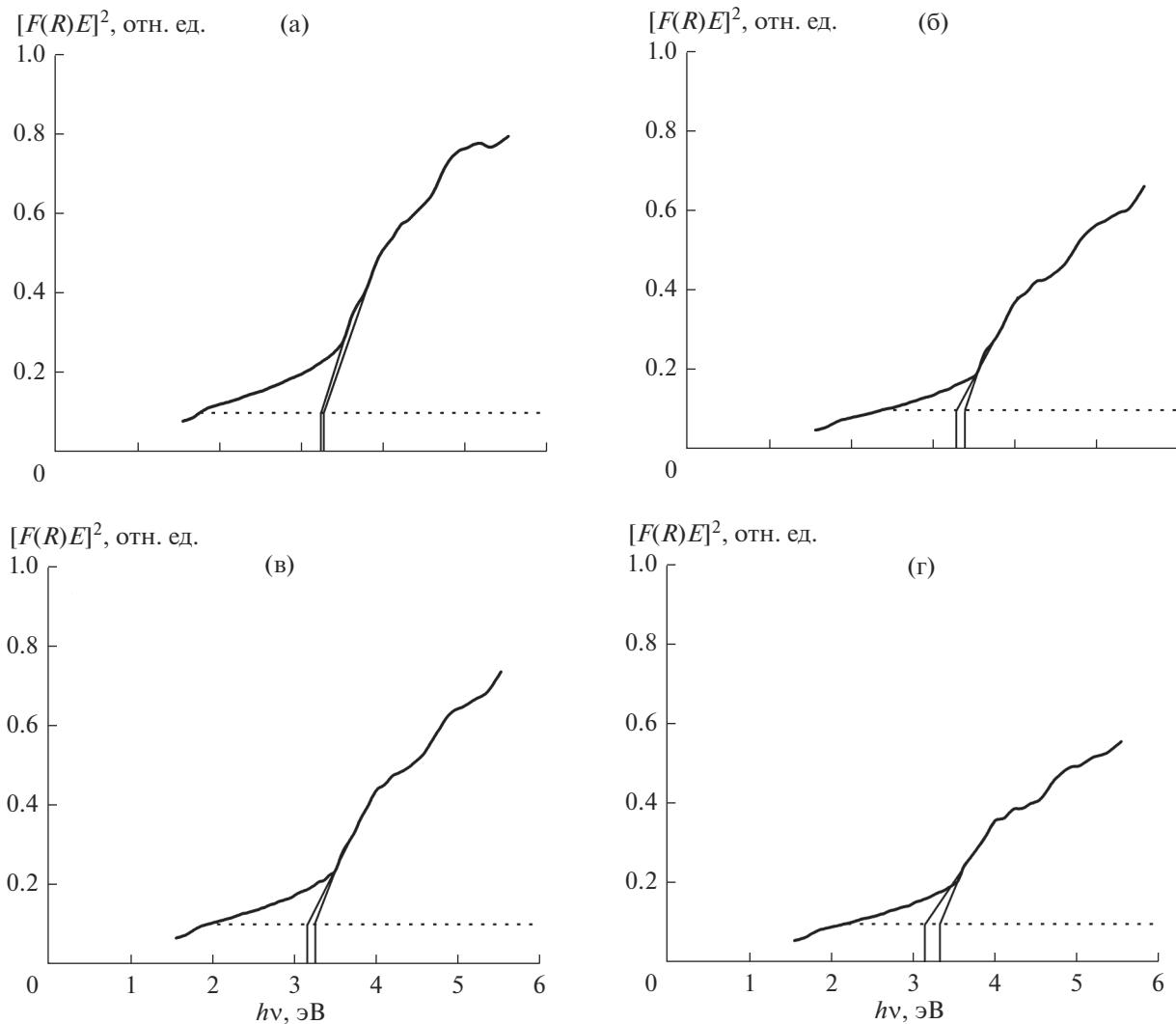


Рис. 5. Зависимости коэффициента поглощения композитов 1 (а), 2 (б), 3 (в), 4 (г) от энергии фотона.

бенностями их поверхности. Наибольшая степень деградации CHL при УФ-облучении наблюдается в присутствии образцов 1 и 2, характеризующихся

более равномерным расположением частиц по поверхности. Наименьшая активность композита 3 обусловлена расположением на поверхности круп-

Таблица 5. Степень адсорбции и фотокаталитической деградации CHL в присутствии композитов при различных условиях ($C_{\text{CHL}} = 25 \text{ мг/л}$, $C_{\text{H}_2\text{O}_2} = 1 \times 10^{-3} \text{ моль/л}$, масса катализатора $m_{kt} = 200 \text{ мг}$, $V_{\text{p-pa}} = 10 \text{ мл}$, $\tau_{\text{УФ}} = 10 \text{ мин}$)

Композит	Fe, ат. %	Адсорбция, %		Деградация, %					
				УФ		видимый свет		видимый свет H_2O_2	
		I	II	I	II	I	II	I	II
1	2–10	52	50	73	81	57	78	82	
2	1.7–18	55	53	75	71	61	78	98	
3	1.3–32	49	53	42	47	49	96	87	
4	3.8–7.3	49	43	63	49	59	72	91	

Примечание. Погрешность результатов не превышает 7–8%; I – крупнодисперсная фракция, II – мелкодисперсная фракция.

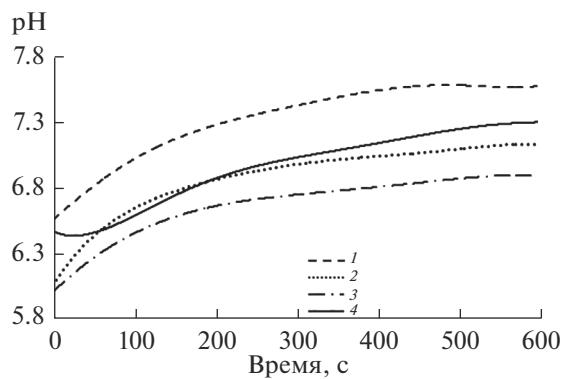


Рис. 6. Кинетические кривые изменения pH водных суспензий композитов.

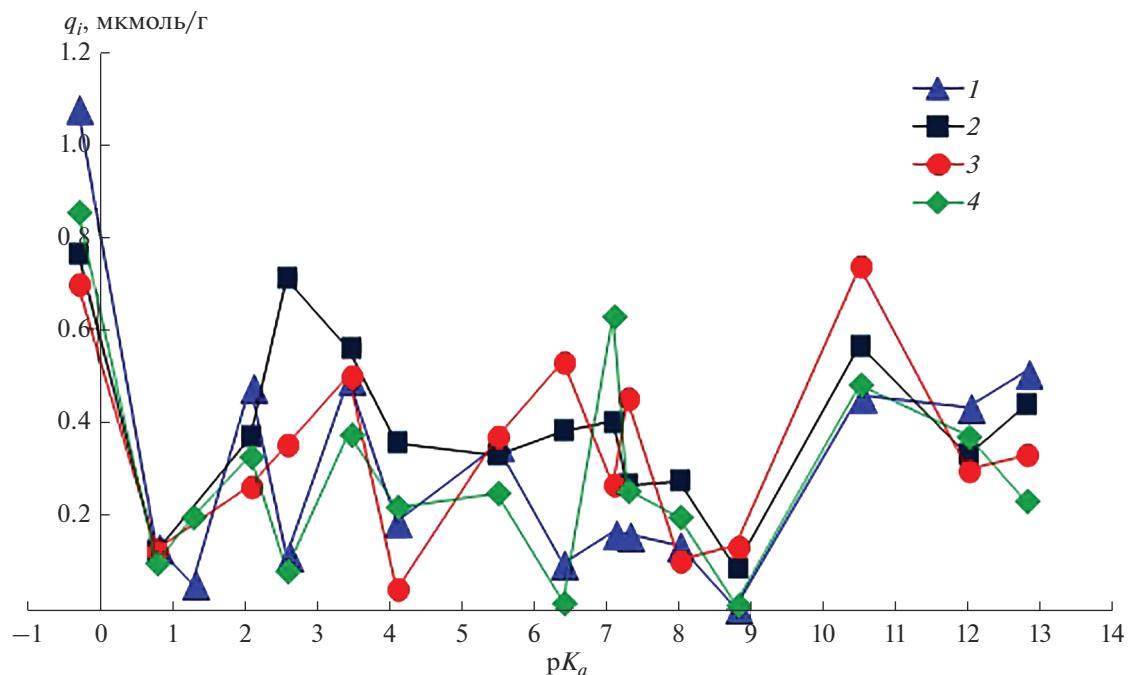


Рис. 7. Распределение центров адсорбции индикаторов на поверхности композитов.

ных шарообразных частиц расплава железа, маскирующих частицы полупроводников. Добавка H_2O_2 создает условия для фото-Фентона-процесса и генерации HO^\cdot -радикалов, что приводит к значительному увеличению степени деструкции CHL. Оптимальные условия для совмещения гетерогенного и гомогенного фотокатализа наблюдаются в присутствии образца 2, что выражается практически в полной (98%) деструкции CHL. Степень адсорбции и деградации CHL при УФ-облучении практически не зависит от дисперсности образцов. При облучении видимым светом значительно увеличивается деструкция CHL (96%) в присутствии мелкодисперсного композита 3, со-

держащего наибольшее количество поверхностного тантала (табл. 1). Вероятно, уменьшение дисперсности частиц способствует поглощению видимого света TaON и указывает на его участие в фотокаталитическом процессе. Невысокая степень деградации CHL (72%) в присутствии образца 4 при облучении видимым светом обусловлена особенностями морфологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом автоволнового горения в азоте ФСА с добавками металлического тантала (5, 10, 15 мас. %) синтезированы железосодержащие металлоке-

рамические композиты. Установлен фазовый состав композитов: основные фазы – $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$, $\beta\text{-Si}_3\text{Al}_3\text{O}_3\text{N}_5$ и $\alpha\text{-Fe}$, дополнительные фазы – Та-ОН, Ta_2O_5 . Увеличение добавки Та в шихту уменьшает температуру горения и влияет на морфологию поверхности синтезированных материалов, делая ее менее однородной. Методом электронной спектроскопии диффузного отражения определена ширина запрещенной зоны полупроводника $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$, которая уменьшается с увеличением добавки тантала в исходную шихту ($E_g = 3.14\text{--}3.25$ эВ).

Изучены интегральные кислотно-основные свойства поверхности композитов, индикаторным методом Гамметта и Танабе установлено количество центров различной кислотности. Проведена оценка адсорбционной и фотокатализической активности композитов в процессе деструкции CHL в условиях УФ- и видимого облучения. Адсорбционная активность композитов к CHL (~50%) определяется количеством активных центров с pK_a 5.5 и 11.3.

Установлены оптимальные условия для совмещения гетерогенного и гомогенного фотокатализа (композит 2, дисперсность 0.65–2.5 мм), приводящие практически к полной деградации CHL (98%) в условиях видимого света и добавки H_2O_2 .

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Исследование выполнено при поддержке Программы развития Томского государственного университета (Приоритет-2030) и государственного задания ТНЦ СО РАН (проект № 121031800148-5).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ribeiro A.R., Nunes O.C., Pereira Manuel F.R. et al. An Overview on the Advanced Oxidation Processes Applied for the Treatment of Water Pollutants Defined in the Recently launched Directive 2013/39/EU // Environ. Int. 2015. V. 75. P. 33–51.
<https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.10.027>
2. Huang J., Li R., Li D. et al. One-Step Synthesis of Phosphorus/oxygen Co-Doped $g\text{-C}_3\text{N}_4$ /Anatase TiO_2 Zscheme Photocatalyst for Significantly Enhanced Visible-Light Photocatalysis Degradation of Enrofloxacin // J. Hazard. Mater. 2020. V. 386. P. 121634.
3. Florent M., Giannakoudakis D.A., Bandosz T. Detoxification of Mustard Gas Surrogate on $\text{ZnO}_2/g\text{-C}_3\text{N}_4$ Composites: Effect of Surface Features' Synergy and Day-night Photocatalysis // Appl. Catal., B. 2020. V. 272.
<https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.119038>
4. Ериов Д.С., Беспрозванных Н.В., Синельщикова О.Ю. Синтез, фотокатализические и электрофизические свойства керамических материалов в системе $\text{PbO}\text{--Bi}_2\text{O}_3\text{--Fe}_2\text{O}_3$ // Журн. неорган. химии. 2022. Т. 67. № 1. С. 118–126.
<https://doi.org/10.31857/S0044457X22010032>
5. Zhang P., Liu B., Li Yu. et al. Egg White-Mediated Synthesis and Application of Ag/CeO₂ Photocatalyst for Enhanced Photocatalytic Activity under Visible Light Irradiation // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. № 14. P. 2036–2044.
<https://doi.org/10.1134/S0036023621140096>
6. Орлов В.М., Седнева Т.А. Синтез и фотокатализические характеристики мезопористого оксинитрида тантала // Перспективные материалы. 2017. № 1. С. 5–12.
7. Duan Li, Liang Zeng, Bin Li et al. Rapid Synthesis of Dielectric Tantalum-Based Oxynitrides // Mater. Des. 2020. V. 187. P. 108416.
<https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108416>
8. Fang C.M., Orhan E., de Wij G.A., Hintzen H.T. The Electronic Structure of Tantalum (oxy)nitrides TaON and Ta_3N_5 // J. Mater. Chem. 2001. № 11. P. 1248–1252.
<https://doi.org/10.1039/B005751G>
9. Qijie Jin, Bingxu Lu, Youchun Pan et al. Novel Porous Ceramic Sheet Supported Metal Reactors for Continuous-Flow Catalysis // Catal. Today. 2019. № 3. P. 324–332.
<https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.12.006>
10. Sherstoboeva M.V., Bavykina A.V., Bolgaru K.A. et al. Metal-Ceramic Composites for Photocatalytic Oxidation of Diclofenac in Aqueous Solution // J. ChemistrySelect. 2020. № 5. P. 1912–1918.
<https://doi.org/10.1002/slct.201904010>
11. Скворцова Л.Н., Болгару К.А., Шерстобоева М.В. и др. Деградация диклофенака в водных растворах в условиях совмещенного гомогенного и гетерогенного фотокатализа // ЖФХ. 2020. Т. 94. № 6. С. 926–931.
<https://doi.org/10.31857/S0044453720060242>
12. Wadley S., Waite T.D. Fenton Processes-Advanced Oxidation Processes for Water and Wastewater Treatment. London: IWA Publishing, 2004. P. 111–135.
13. Нечипоренко А.П., Кудряшова А.И. Исследование кислотности твердых поверхностей методом pH-метрии // ЖПХ. 1987. Т. 60. № 9. С. 1957–1961.
14. Нечипоренко А.П. Донорно-акцепторные свойства поверхности твердофазных систем. Индикаторный метод. СПб: Лань, 2017. 2843 с.
15. Гриценко В.А. Электронная структура нитрида кремния // Успехи физических наук. 2012. Т. 182. № 5. С. 531–541.
<https://doi.org/10.3367/UFNr.0182.201205d.0531>
16. Artukh I.A., Bolgaru K.A., Dychko K.A. et al. Hydrogen Production by Photocatalytic Degradation of Organic Substances Using Iron-Containing Metal-Ceramic Composites Under UV and Visible-Light Irradiation // J. ChemistrySelect. 2021. № 6. P. 10025–10032.
<https://doi.org/10.1002/slct.202102014>
17. Cheng M., Zeng G., Huang D. et al. Hydroxyl Radicals Based Advanced Oxidation Processes (AOPs) for Remediation of Soils Contaminated with Organic Compounds: A review // Chem. Eng. J. 2016. V. 284. P. 582–598.
<https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.09.001>